03

Радиационно-стимулированный фазовый переход в суперионное состояние кристалла TISe

© Р.М. Сардарлы¹, Н.А. Алиева¹, Ф.Т. Салманов¹, С.М. Гахраманова¹, Р.Н. Мехтиева¹, Р.Ш. Агаева²

1 Институт радиационных проблем НАН Азербайджана,

АZ1143 Баку, Азербайджан

2 Мингечаурский государственный университет,

Мингечаур, Азербайджан

E-mail: sardarli@yahoo.com

Поступила в Редакцию 8 июля 2022 г. В окончательной редакции 8 июля 2022 г. Принята к публикации 27 июля 2022 г.

Исследованы температурно-частотные зависимости: электрической проводимости $(\sigma(\mu,T))$, действительной и мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости $(\varepsilon'(\nu,T))$ и $(\varepsilon''(\nu,T))$, комплексный импеданс соединения TISe при воздействии различных доз гамма радиации. Исследован процесс возникновения концентрационной поляризации на границе ионный проводник блокирующий контакт. Установлен температурно-частотно-дозовый интервал возникновения ионной проводимости, импеданса Варбурга и обнаружен, радиационно стимулированный фазовый переход в суперионное состояние кристалла TISe.

Ключевые слова: комплексный импеданс, блокирующий контакт, ионной проводимости.

DOI: 10.21883/FTT.2022.12.53640.428

1. Введение

Воздействие радиационного излучения на твердые тела приводит к изменению их структурно-фазовых состояний и физических свойств. В основе радиационностимулированных методов обработки материалов лежит управляемое изменение электрофизических свойств, путем создания в них структурных дефектов, меняющих энергетический спектр материала создание новых фаз. В настоящее время основное внимание уделяется физической природе радиационных-стимулированных модификаций свойств соединений и создание новых структур.

Разработка современных материалов для создания ионистов, ионных проводников, миниаккумуляторов, топливных элементов и других устройств, работа которых основана на особенностях проводимости твердых электролитов (суперионных проводников), зависит от поиска новых соединений, которые имеют соответствующий электронный и фононный спектр, а также соответствующую структуру.

Характерными особенностями суперионных кристаллов являются: наличие подвижных ионов в кристалле, которых должно быть больше, чем соответствующих кристаллографических позиций; слабая энергия разупорядочения ионов по позициям; существование связанной сетки каналов проводимости.

Соединение TISe кристаллизуется в объемно-центрированной цепочечной структуре, симметрии D^{18}_{4h} (I4/mcm). Отличительной особенностью этой структуры является нахождение атомов таллия в двух разных валентных состояниях Tl^+ и Tl^{3+} и, соответственно в двух различных кристаллографических положениях, ионы Tl^{3+} и их ближайшее тетраэдрическое окружение, ко-

торое состоит из четырех ионов Se^{2-} , образуют отрицательно заряженные цепи $\mathrm{Se}^{2-}_2-\mathrm{Tl}^{3+}-\mathrm{Se}^{2-}_2$ направленные вдоль тетрагональной оси. Одновалентные ионы Tl^{+1} находятся между четырьмя цепочками и при этом имеют октаэдрическое окружение из восьми ионов Se^{2-} [1]. Фрагменты этих цепочек связаны между собой ионами Tl^{+1} , поэтому формулу соединения можно выразить в виде $\mathrm{Tl}^+[\mathrm{Tl}^{3+}\mathrm{Se}^{2-}_2]$. Цепочки связаны между собой слабой ван-дер-вальсовой связью ионами Tl^{1+} (рис. 1).

В настоящей работе приводятся результаты исследований температурно-частотной зависимости ионной про-

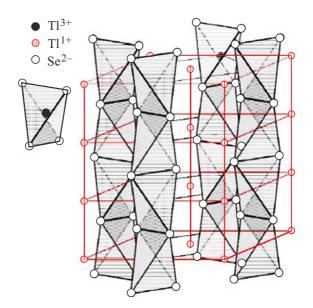


Рис. 1. Кристаллическая структура TlSe.

водимости и импеданса кристалла TISe при воздействии различных доз γ -радиации.

2. Методика эксперимента

Синтез соединения TISe проведен прямым сплавлением высокочистых исходных компонентов в вакуумированных ($\sim 10^{-2}\,\mathrm{Pa}$) и запаянных кварцевых ампулах. Монокристаллы выращивались вертикальным методом Бриджмена. В синтезе использовали высокочистые элементарные компоненты производства Evochem Advanced Materials GMBH (чистота не менее 99.99). Учитывая высокое давление паров селена при температуре плавления, синтез соединения проводили в двузонном режиме. После синтеза образец проходил процедуру отжига при температуре 400 К. Синтезированные образцы идентифицировали методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и рентгенофазового анализа (РФА).

Монокристаллы выращивались вертикальным методом Бриджмена. Для измерений температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и электропроводности материалов TISe были изготовлены конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемых материалов. Обкладки конденсаторов были получены нанесением серебряной токопроводящей пасты на поверхности пластинок. Исследования комплексной диэлектрической проницаемости ($\varepsilon^* = \varepsilon' + \varepsilon''$) и электропроводности проводились цифровым измерителем иммитанса E7-25 на частотах $20-10^6$ Hz в интервале температур 100-450 K. Амплитуда измерительного поля не превышала $1 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1}$.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Температурная зависимость проводимости

На рис. 2 приводится температурная зависимость электрической проводимости для кристалла TISe подвергнутых облучению γ -квантов.

Во вкладке к рисунку приводится та же зависимость в координатах $\ln(\sigma T)$ от 1000/T. Измерения выполнены при дозах γ -облучения 0; 0.25 и 0.75 MGy. Как видно из рисунка с ростом дозы радиационного воздействия кривые (I, 2 и 3) наблюдается резкий рост проводимости с ростом дозы облучения. Как видно из вкладки к рисунку, экспериментальные точки температурной зависимости $\ln(\sigma T)$ от 1000/T в области резкого скачка электропроводности хорошо укладываются на прямую линию, которая для случая ионной проводимости описывается уравнением [2,3]:

$$\sigma T = \sigma_0 \exp(-\Delta E/kT)$$
.

Здесь ΔE — энергия активации проводимости, k — постоянная Больцмана. Наблюдаемый резкий рост электропроводности в кристалле TISe, при росте дозы облучения, можно объяснить резким ростом энергетически

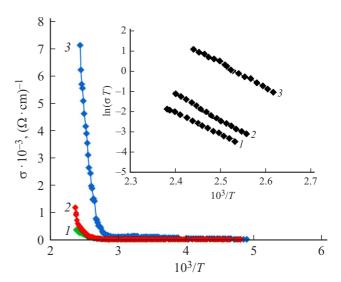


Рис. 2. Температурная зависимость проводимости кристалла TISe подвергнутых облучению γ -квантов. Во вкладке приводится та же зависимость в координатах $\ln(\sigma T)$ от 1000/T. Цифрами 1,2 и 3 показаны дозы γ -облучения, 0, 0.25 и 0.75 MGy соответсвенно.

эквивалентных кристаллографических позиций, вызванных радиационными дефектами. При этом, размещения подвижных ионов в кристалле становится больше, чем самих кристаллографических октаэдрических позиций занимаемых Tl^{+1} до радиационного воздействия. Кристаллографическая структура соединения TISe состоит из анионных цепочек, образованных тетраэдрами TISe4 (рис. 1). Ионы Tl^{+1} расположены в октаэдрических пустотах между цепочками TISe4. Из кристаллохимических соображений следует, что цепочечная структура кристаллов TISe и позиция ионов Tl^{+1} в наибольшей степени способствуют мобильности ионов таллия.

Во вставке к рис. 2 приводится зависимость $\ln(\sigma T)$ от 1/T, при температурах выше скачка проводимости для образцов подвергнутых радиационному воздействию дозами: 0 (исходные); 0.25 и 0.75 МGу кристаллов TISe. Наблюдается рост проводимости с увеличением поглощенной дозы. Наличие цепочечной структуры кристалла TISe, а также, существование ионов TI^{+1} в октаэдрических пустотах, которые связаны слабой ван-дер-вальсовой связью с цепочками образованными тетраэдрами $TISe_4$, образуют каналы проводимости для ионов TI^{+1} .

3.2. Частотная зависимость проводимости

На низких частотах ($\nu < 10^6\,{\rm Gz}$) проводимость по делокализованным состояниям не испытывает частотной дисперсии. На этих частотах реальная часть проводимости определяется фононным механизмом, и с ростом частоты бесфононная проводимость начинает преобладать над релаксационной проводимостью. Степенная зависимость указывает на то, что перенос заряда происходит

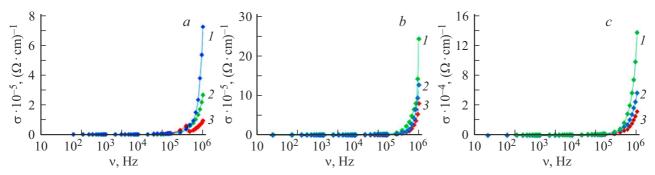


Рис. 3. Частотная зависимость электрической проводимости кристалла TISe. Измерения выполнены при температурах: I = 300, 2 = 350 и 3 = 400 K, и при дозах γ -облучения: a = 0; b = 0.25; c = 0.75 MGy.

за счет прыжков носителей. Такое поведение частотной зависимости проводимости характерно для прыжков носителей по локализованным состояниям. На низких частотах, частотная зависимость действительной части проводимости близка к линейной $s\sim1$. Таким образом, решение задачи, связанной с определением конкретного механизма переноса заряда, связано со структурными особенностями, а именно, характером беспорядка. Результаты исследований частотной зависимости проводимости кристаллов TISe при T=300, 350 и 400 К и дозах γ -облучения 0, 0.25 и 0.75 MGy представлены на рис. 2.

Как видно из рисунков, кривые $\sigma(\lg \nu)$, построенные для необлученных образцов кристалла TlSe (кривые, а на рис. 3), можно разделить на два участка: измерения, выполненные при низких температурах (300 и 350 К) и низких частотах < 10³ Hz. При этих экспериментальных условиях наблюдается слабая частотная зависимость проводимости. Значительная дисперсия наблюдается при измерениях на частотах выше $> 10^3$ Hz. При тех же температурах, и в том же диапазоне частот образцы кристалла TlSe, облученные у-квантами дозой 0.25 MGy, имеют слабую частотную зависимость (кривые b на рис. 3). Такое поведение зависимости $\sigma(\lg v)$ при облучении квантами дозой 0.25 MGy может быть связано с радиационным отжигом образцов, приводящим к "залечиванию" исходных, неконтролируемых дефектов в кристалле TISe.

Измерения, проведенные при температуре 400 K на образцах, облученных γ -квантами дозой 0.75 MGy (кривые c на рис. 3), показывают значительное увеличение проводимости и дисперсии. Такое поведение проводимости кристаллов TISe может быть связано с увеличением ионной составляющей проводимости, то есть при дозе облучения 0.75 MGy и температуре 400 K происходит фазовый переход кристалла в суперионное состояние. Характерной особенностью исследуемой зависимости $\sigma_{\rm AC} \sim (f)$ является то, что на низких частотах она выражается в виде $\sigma_{\rm AC} \sim f^{0.6}$, а в диапазоне частот $f \sim 5 \cdot 10^5$ Hz эта зависимость оказывается равной $\sigma_{\rm AC} \sim f^{0.8}$. Такая частотная зависимость, согласно [4], характеризует проводимость по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми.

3.3. Импеданс

Методы импедансной спектроскопии применяются при исследовании электрофизических процессов, протекающих на границе раздела электрод ионопроводящий материал, диэлектрических и транспортных свойств материалов, установления механизма электрохимических реакций, исследования свойств пористых электродов. Нами выполнены измерения действительной и мнимой частей импеданса образцов соединения TISe при температурах 300, 350 и 400 К и дозах γ -облучения 0; 0.25 и 0.75 MGy. Полученные данные представлены в виде годографа импеданса на комплексной плоскости (рис. 4). Измерения выполнены в частотном диапазоне $20-10^6$ Hz.

На рис. 4, a(1) приводятся зависимость Z''(Z') полученная при 300 К и 0 МGу, как видно из рисунка, зависимость представляет собой прямую. Эта зависимость свидетельствует о том, что при этих значениях температуры и отсутствия радиационного воздействия, ионный перенос еще не начался, т.е. фазовый переход в суперионное состояние еще не произошел. Кривая, полученная при комнатной температуре, и после радиационного воздействия дозой $0.25\,\mathrm{MGy}$ приводится на рис. 4, $b\left(1\right)$. На рис. 4, c(I) представлен годограф зависимости Z''(Z')измеренный при 300 K и дозе облучения 0.75 MGy. Как видно из этих рис. (a(1), b(1)) и c(1), кривая годографа импеданса кристалла TISe, с ростом дозы облучения, деформируется от линейной зависимости (рис. 4, a(1)), до полуокружности (рис. 4, c(1)), центры, которых расположены на действительной оси, при этом процесс переноса заряда характеризуется одним временем релаксации. Зависимость, приведенная на рис. 4, c(1), представляет собой годограф, соответствующий однородному образцу с низкоомным и неблокирующим контактом. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что кристаллы TISe, при комнатной температуре, и при облучении у-лучами дозой в 0.75 MGy испытывает радиационно-стимулированный фазовый переход в суперионное состояние.

Значения частот (f_{\max}) , соответствующие максимуму Z''(Z'), и их времена релаксаций (τ) , частоты, соответ-

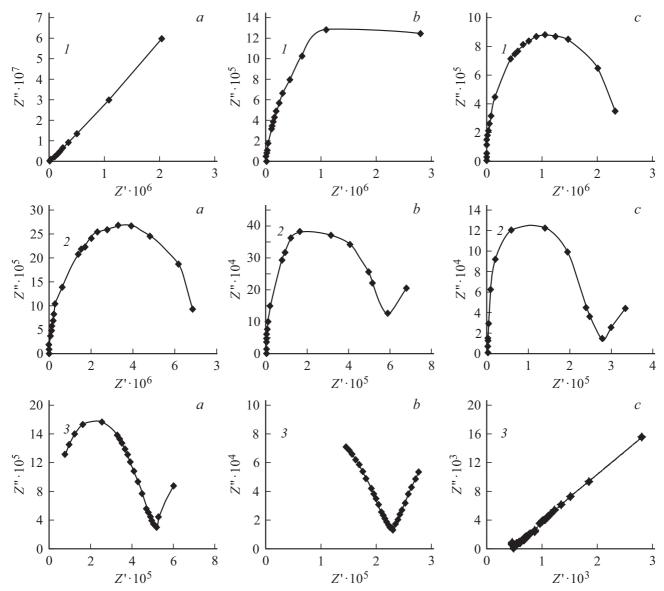


Рис. 4. Годограф импеданса Z''(Z') кристалла TISe. Измерения выполнены при температурах: 1-300; 2-350 и 3-400 K, и при дозах γ -облучения: a(1,2,3)-0; b(1,2,3)-0.25; c(1,2,3)-0.75 MGy.

ствующие началу дисперсии $(f_{\rm jamp})$, для образцов кристалла TISe при 300; 350 и 400 К и дозах γ -облучения: 0; 0.25; 0.75 Mgy (таблица).

Как видно из таблицы и рис. 4, мнимые части импеданса обнаруживают максимум при частотах $f_{\rm max}$, соответствующих условию $C_{\rm eff}R_{\rm eff}\omega_{\rm max}=1$, где $C_{\rm eff}$ и $R_{\rm eff}$ — эффективные параметры эквивалентной схемы, $\omega_{\rm max}=2\pi f_{\rm max}$ — круговая частота. На необлученных образцах рис. 4 (a(I);b(1);c(I)), с ростом температуры растет частота $f_{\rm max}$, соответствующая максимуму Z''. Как видно из рис. 4, a(I), зависимость Z''(Z') имеет линейный характер, такая зависимость проводимости, характерна для бесфононной (резонансной) прыжковой проводимости локализованных носителей заряда.

Кривые, приведенные на рис. 2, a, b, c — это кривые, измеренные при 350 K, и получившие дозы облучения:

a — 0; b — 0.25; c — 0.75 MGy. Как видно из рис. 2, a, при температуре 350 K на необлученных образцах кристалла TISe, на комплексной плоскости видна дуга годографа, которая свидетельствует о том, что кристалл перешел в состояние с ионной проводимостью. Дальнейший рост поглощенной дозы (b — 0.25; c — 0.75 MGy) приводит к возникновению "лучей" в низкочастотной области годографа. Таким образом, наблюдаемые лучи при температуре 350 K и дозах b — 0.25; c — 0.75 MGy свидетельствуют о дополнительных вкладах в проводимость, которая, по всей видимости, связана с диффузным переносом ионов Tl^{1+} в интерфейсе ионный проводник и электрол.

Возникновение "лучей" в низкочастотной области годографа импеданса кристалла TISe свидетельствует о наличии диффузного импеданса Варбурга [5]. На рис. 4

Значения частот (f_{max}) , соответствующие максимуму Z''(Z'), и их времена релаксаций (τ) , частоты, соответствующие началу дисперсии (f_{jamp}) , для образцов кристалла TISe при 300; 350 и 400 К и дозах γ -облучения: 0; 0.25; 0.75 Mgy

TlSe	T (K)	f may (kHz)	$\tau = 1/2\pi f_{\rm max}$	figure (kHz)
	1 (11)	J max (KIIZ)	t 1/20t J max	J Jamp (KILZ)
0 MGy	300	_	_	2
	350	0.4	$3.9 \cdot 10^{-4}$	20
	400	30	$5.3 \cdot 10^{-6}$	60
0.25 MGy	300	0.1	$1.5\cdot 10^{-3}$	4
	350	0.6	$2.6 \cdot 10^{-4}$	30
	400	60	$2.65 \cdot 10^{-6}$	_
0.75 MGy	300	1	$1.5 \cdot 10^{-4}$	50
	350	3	$5.3 \cdot 10^{-5}$	80
	400	_	_	

кривые 3 отражают результаты измерений импеданса кристалла TISe при 400 K и при дозах радиационного воздействия в 0, 0.25 и 0.75 МGy соответственно кривые 3(a, b, c). Как видно из рис. 3, a, на необлученных образцах при 400 К видна дуга на годографе импеданса, а также, "луч", который мы связываем с диффузным ионным переносом в приконтактной области кристалла TISe (ионный проводник) — электрод (Ag). При дальнейшем увеличении облучаемой дозы, кривые 3(b и c) на рис. 4 дуга годографа импеданса смещается в высокочастотную область. При этом луч, на кривой импеданса, также смещается в область высоких частот. При облучении дозой 0.75 МGу, дуга годографа продолжает смещаться в область высоких частот (кривая 3(c)) и его измерение выходит за пределы наших экспериментальных возможностей. В то же время, на рис. 3, c остается ранее наблюдаемый "луч" в низкочастотной области годографа, который связывается нами с поляризационной емкостью и сопротивлением приэлектродной области. Т.е., годограф импеданса, представленный на рис. 4,3(c) моделирует импеданс линейной диффузии, известный как диффузный импеданс Варбурга [5,6,7,8].

Как видно из кривых годографов импеданса кристалла TISe приведенных на рис. 4, "лучи" на низкочастотной области диаграмм возникают, как при росте температуры, так и при увеличении облученной дозы. Известно [6], что процессы, происходящие на границе раздела различных проводящих материалов описываются в рамках модели частотного отклика, что связано с наличием, поляризационного сопротивления в приэлектродной области, так и поляризационной емкостью, связанной с накоплением заряда в области двойного электрического слоя.

4. Заключение

Температурно-частотные исследования проводимости и импеданса кристалла TISe подвергнутым различным дозам γ -облучения (0, 0.25 и 0.75 MGy), позволили установить радиационно-стимулирующее влияние на характер переноса заряда в исследуемом кристалле. Показано, что в результате воздействия γ -квантов, в объеме кристалла, меняется характер проводимости. В образцах, не подвергнутых облучению, перенос заряда осуществляется электронами, радиационное воздействие приводит к тому, что проводимость становится преимущественно ионной (суперионной). Кроме того, показано, что γ -облучение сильно влияет на ионно-поляризационные процессы, происходящие в приконтактной области, что приводит к возникновению диффузного импеданса Варбурга, вызванного γ -облучением.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Список литературы

- A.M. Panich, R.M. Sardarly. Physical Properties of the Low Dimensional A₃B₆ and A₃B₃C₂⁶ Compounds. Nova Science Publishers, N.Y. (2010).
- [2] A.S. Nowick, A.V. Vaysleyb, I. Kuskovsky. Phys. Rev. B 58, 8398 (1998).
- [3] Ю.Я. Гуревич, Ю.И. Харкац. Особенности термодинамики суперионных проводников. УФН, **136**, *4*, 693 (1982).
- [4] N. Mott, E. Davis. Electronic processes in non-crystalline substances. Мир, М. (1982).
- [5] Р.М. Сардарлы, А.П. Абдуллаев, Н.А. Алиева, Ф.Т. Салманов, М.Ю. Юсифов, А.А. Оруджева. ФТП 52, 1111 (2018).
- [6] J.R. Macdonald. Impedance Spectroscopy. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey (2005). 595 p.
- [7] R.M. Sardarly, N.A. Aliyeva, F.T. Salmanov, R.M. Abbasova. Mod. Phys. Lett. B 34, 5, 2050113-1-2050113-12 (2020).
- [8] R.M. Sardarly, N.A. Aliyeva, F.T. Salmanov, R.N. Mehdiyeva, S.M. Gakhramanova. Mod. Phys. Lett. B 35, 33, 2150504-1-1-2150504-9 (2021).

Редактор К.В. Емцев